

在异丙醇中微量镉、铜的电沉积

@周志宏 @魏连生 @樊芝草

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

摘要 研究了在异丙醇中镉的电沉积行为。提出了镉、铜电沉积制源的程序。亚微克量的镉、铜在异丙醇(pH=3—4)中电镀70分钟(密电流度10毫安/厘米²,电压1000伏左右),镉的沉积率为96.0±0.7%,铜的沉积率为95.7±0.4%。

关键词

分类号

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(173KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

Abstract

Key words

DOI

通讯作者